



รอยต่อโลหะกับสารกึ่งตัวนำ

ในบทนี้จะพิจารณาว่าค่าแรงศักย์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลหะถูกนำมาติดกับสารกึ่งตัวนำเกิดขึ้นเพราะอะไร และควรจะทำอย่างไรถ้าไม่ต้องการให้เกิดค่าแรงศักย์

4.1 สาเหตุของการเกิดค่าแรงศักย์ 1181

การเกิดค่าแรงศักย์เนื่องจากโลหะติดกับสารกึ่งตัวนำมีสาเหตุเพราะ

- ก. ค่าเว็รคฟังก์ชัน (work function) ของโลหะกับของสารกึ่งตัวนำไม่สอดคล้อง (matching) กัน
- ข. เกิดมีสถานะผิว (surface state) บนผิวของสารกึ่งตัวนำ สถานะผิวนี้เกิดจากการสิ้นสุดความเป็นคาบที่ผิวของผลึก
- ค. มีชั้นบาง ๆ ของสารอื่นที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ ชั้นบาง ๆ นี้ทำให้เกิดค่าแรงศักย์ขึ้นได้ เพราะเหตุผลข้อ ก และ ข

4.1.1 ค่าแรงศักย์เกิดจากความไม่สอดคล้องของเว็รคฟังก์ชันของโลหะกับสารกึ่งตัวนำ

ก่อนอื่นจะกล่าวถึงนิยามของเว็รคฟังก์ชันและอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี (electron affinity) เสียก่อน

เว็รคฟังก์ชันของโลหะคือ ϕ_m หมายถึงพลังงานที่ใช้ในการยกอิเล็กตรอนจากระดับเฟอร์มี (Fermi level) ของโลหะไปยังระดับสุญญากาศ (vacuum level) ของโลหะ

เว็รคฟังก์ชันของสารกึ่งตัวนำคือ ϕ_s หมายถึงพลังงานที่ใช้ในการยกอิเล็กตรอนจากระดับเฟอร์มีของสารกึ่งตัวนำไปยังระดับสุญญากาศของสารกึ่งตัวนำ

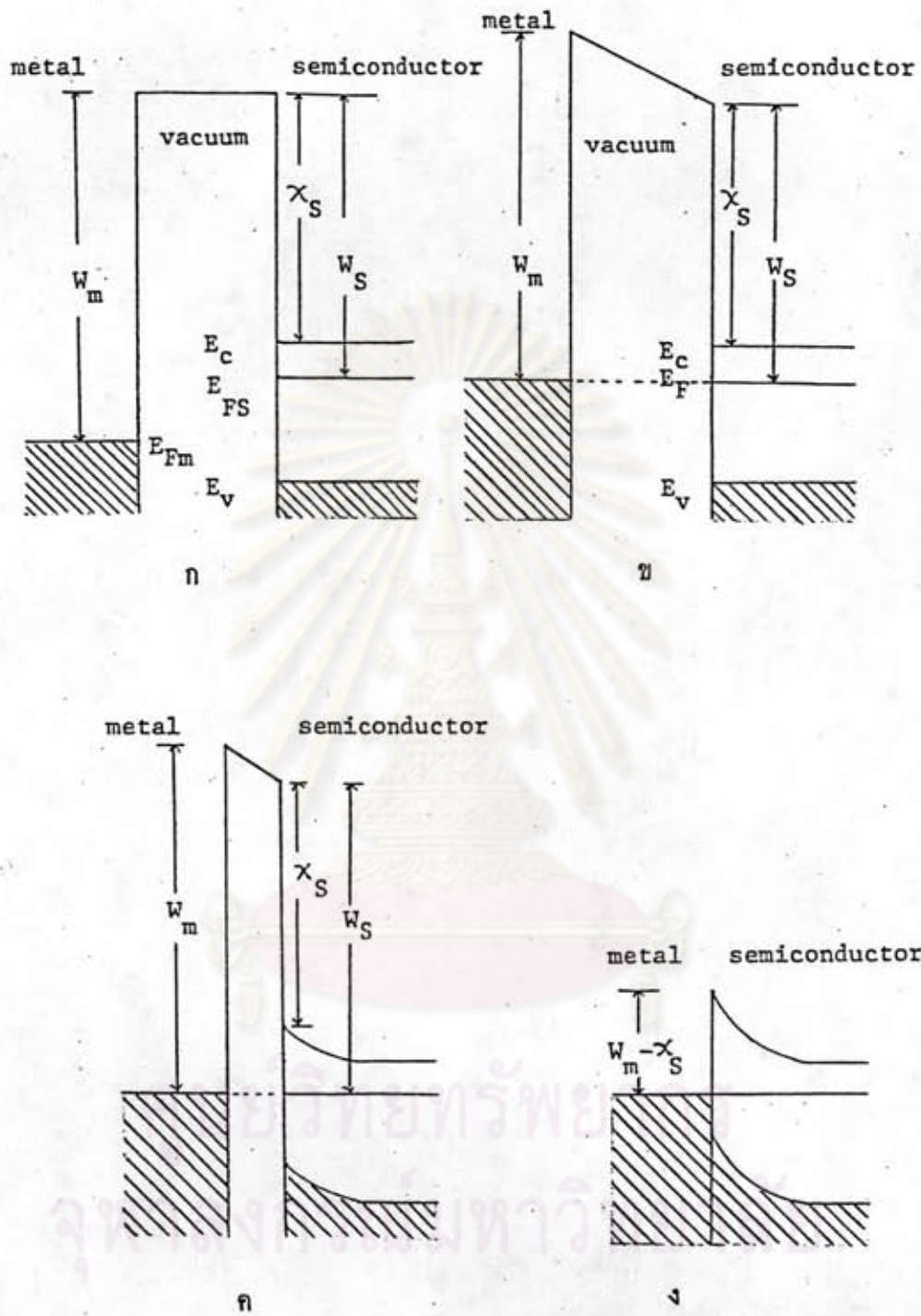
อิเล็กตรอนแอฟฟินิตีของสารกึ่งตัวนำคือ χ_s หมายถึงพลังงานที่ใช้ในการยกอิเล็กตรอนจากขอบล่าง (bottom edge) ของแถบนำของสารกึ่งตัวนำไปยังระดับสุญญากาศของสารกึ่งตัวนำ

ถ้าโลหะมีค่าเว็รคฟังก์ชัน w_m ถูกนำมาต่อกันกับสารกึ่งตัวนำที่มีค่าเว็รคฟังก์ชัน w_s และมีค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี χ_s

และถ้าเว็รคฟังก์ชันของโลหะไม่เท่ากับของสารกึ่งตัวนำ ซึ่งก็คือระดับเฟอร์มิของทั้งสองไม่เท่ากัน อิเล็กตรอนอิสระจะไหลจากตัวที่มีเว็รคฟังก์ชันน้อยคือตัวที่ระดับเฟอร์มิสูงกว่าไปยังตัวที่มีเว็รคฟังก์ชันมากคือตัวที่มีระดับเฟอร์มิต่ำกว่า ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระของสารกึ่งตัวนำจะไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดการโค้งของแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำ ซึ่งการโค้งนี้อาจทำให้เกิดก่าแพงศักย์ขึ้นได้ เพื่อความเข้าใจจะแบ่งการพิจารณาเป็น 4 ขั้นตอน ดังในรูป 4.1 คือ

- ก. เมื่อโลหะกับสารกึ่งตัวนำอยู่ห่างกัน
- ข. เมื่อโลหะและสารกึ่งตัวนำอยู่ในสมดุลความร้อน (thermal equilibrium) แต่ยังคงอยู่ห่างกัน
- ค. พิจารณาต่อจากข้อ ข โดยขยับให้โลหะและสารกึ่งตัวนำเข้าใกล้กัน
- ง. พิจารณาต่อจากข้อ ค เมื่อโลหะติดกันกับสารกึ่งตัวนำ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.1 แสดงการเกิดกำแพงศักย์เนื่องจากโลหะกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
เมื่อ $W_m > W_s$

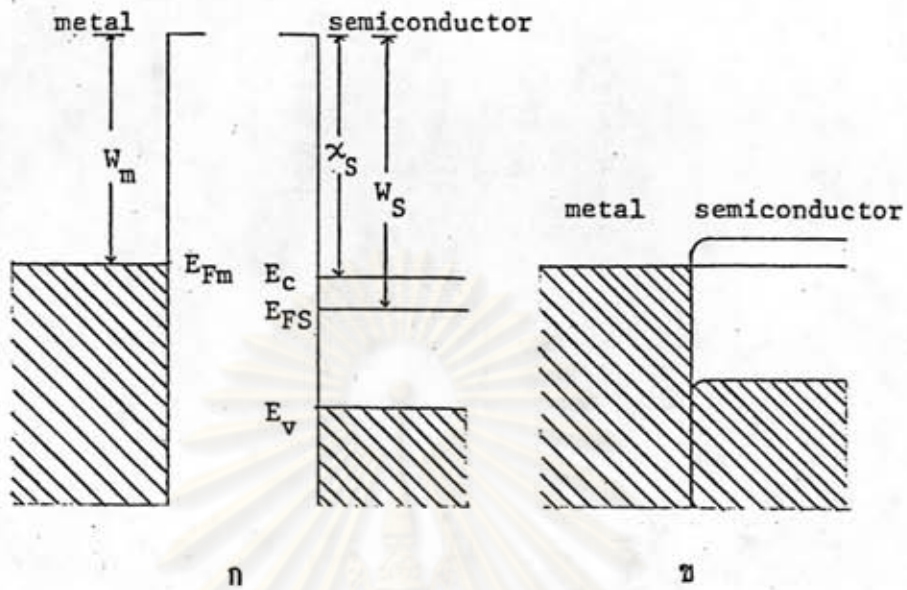
รูป 4.1 ก. แสดงให้เห็นระดับพลังงานของโลหะและของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น โดย $w_m > w_s$ เมื่ออยู่ห่าง ๆ กัน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนในรูป 4.1 ก. นี้ สมมติให้ระดับสุญญากาศของโลหะเป็นระดับเดียวกับระดับสุญญากาศของสารกึ่งตัวนำ

รูป 4.1 ข. แสดงเมื่อโลหะและสารกึ่งตัวนำอยู่ในสมดุลความร้อน แต่ยังคงอยู่ห่างกัน ซึ่งทำได้โดยการต่อสายไฟเข้ากับโลหะและสารกึ่งตัวนำในรูป 4.1 ก. เนื่องจากระดับเฟอร์มิของสารกึ่งตัวนำสูงกว่าของโลหะ อิเล็กตรอนอิสระจึงไหลจากสารกึ่งตัวนำไปยังโลหะ โดยจะหยุดไหลเมื่อระดับเฟอร์มิของทั้งสองเท่ากัน ถ้าโลหะกับสารกึ่งตัวนำอยู่ห่างกันเป็นอนันต์ (infinity) จะมีประจุลบกระจายอย่างสม่ำเสมอในโลหะ และจะมีประจุบวกกระจายอย่างสม่ำเสมอในสารกึ่งตัวนำ จึงทำให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระกระจายอย่างสม่ำเสมอในสารกึ่งตัวนำ แถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำจึงไม่โค้ง

รูป 4.1 ค. เมื่อขยับรูป 4.1 ข. ให้โลหะและสารกึ่งตัวนำเข้าใกล้กัน ตรงใกล้ ๆ รอยต่อทางด้านโลหะจะเห็นมีประจุลบเพิ่มขึ้น และตรงใกล้ ๆ รอยต่อทางด้านสารกึ่งตัวนำจะเห็นมีประจุบวกเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระของสารกึ่งตัวนำตรงใกล้ ๆ รอยต่อจะลดลง แถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำตรงใกล้ ๆ รอยต่อจึงโค้งขึ้น [19]

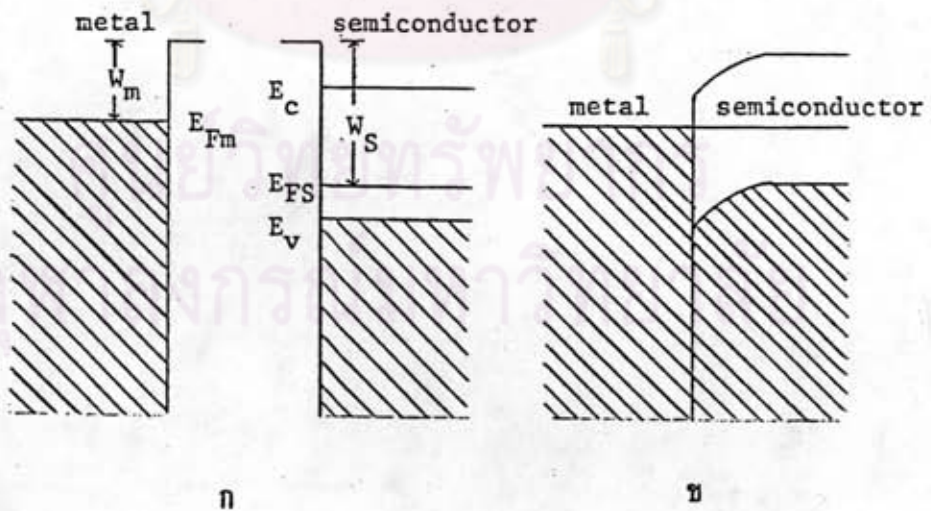
รูป 4.1 ง. เมื่อโลหะติดกับสารกึ่งตัวนำ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระของสารกึ่งตัวนำตรงใกล้ ๆ รอยต่อจะลดลงอีก แถบพลังงานจึงโค้งขึ้นอีก การโค้งของแถบพลังงานจะเป็นก้ำกึ่งกั๊กคอยขวางกันการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ เรานิยามว่า ความสูงของก้ำกั๊กในกรณีนี้คือ $w_m - \chi_s$

ในกรณีสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ถ้า $w_m < w_s$ อิเล็กตรอนอิสระจะไหลจากโลหะไปยังสารกึ่งตัวนำ และแถบพลังงานจะโค้งลงดังรูป 4.2 รอยต่อแบบนี้เป็นรอยต่อแบบโอห์มมิก ซึ่งเป็นรอยต่อที่เราต้องการ

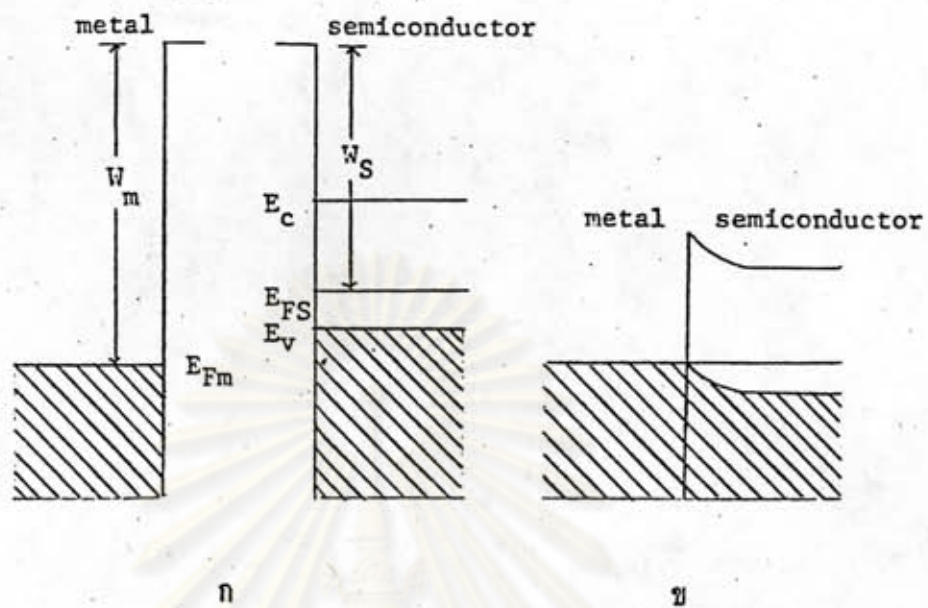


รูปที่ 4.2 แสดงรอยต่อแบบโอห์มมิกในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเมื่อ $w_m < w_s$

ถ้าเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพีจะเกิดค่าแพ่งศักย์เมื่อ $w_m < w_s$ ดังรูป 4.3 และจะเกิดรอยต่อแบบโอห์มมิกเมื่อ $w_m > w_s$ ดังรูป 4.4



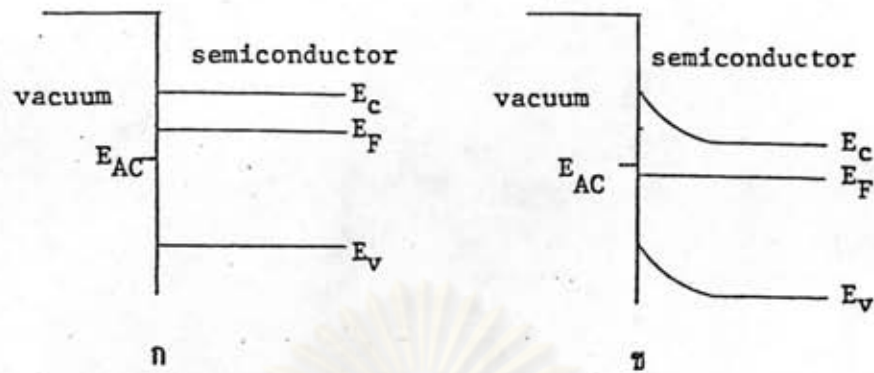
รูปที่ 4.3 แสดงการเกิดค่าแพ่งศักย์ในสารกึ่งตัวนำชนิดพีเมื่อ $w_m < w_s$



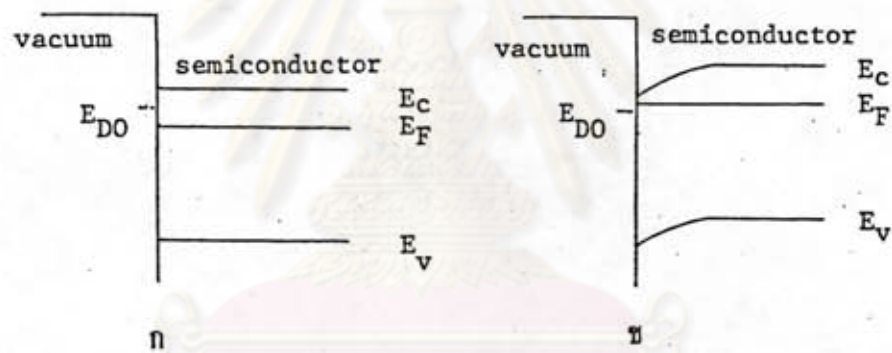
รูปที่ 4.4 แสดงรอยต่อแบบโอห์มิกในสารกึ่งตัวนำชนิดพีเมื่อ $w_m > w_s$

4.1.2 กำแพงศักย์เกิดจากสถานะผิวของสารกึ่งตัวนำ [20]

เมื่อความเป็นคาบของผลึกสิ้นสุดลงที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ จะทำให้เกิดสถานะผิวขึ้น โดยสถานะผิวนี้อาจเป็นสถานะเสมือนแอกเซพเตอร์ (acceptor like) คือ E_{AC} หรืออาจเป็นสถานะเสมือนคอนเนอร์ (donor like) คือ E_{DQ} ถ้าระดับพลังงานของสถานะผิวที่เสมือนแอกเซพเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับเฟอร์มิของสารกึ่งตัวนำ อิเล็กตรอนอิสระจะไหลจากสารกึ่งตัวนำไปยังผิว ทำให้แถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำโค้งขึ้น ดังรูป 4.5 หรือถ้าระดับพลังงานของสถานะผิวที่เสมือนคอนเนอร์อยู่เหนือระดับเฟอร์มิของสารกึ่งตัวนำ อิเล็กตรอนอิสระจะไหลจากผิวไปยังสารกึ่งตัวนำ ทำให้แถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำโค้งลง ดังรูป 4.6



รูปที่ 4.5 แสดงการโค้งของแถบพลังงานในสารกึ่งตัวนำชนิดอื่นเนื่องจากสถานะผิว E_{AC} ที่เสมือนแอกเซพเตอร์



รูปที่ 4.6 แสดงการโค้งของแถบพลังงานในสารกึ่งตัวนำชนิดอื่นเนื่องจากสถานะผิว E_{DO} ที่เสมือนคอนเนอร์

แต่ถ้าระดับพลังงานของสถานะผิวที่เสมือนแอกเซพเตอร์อยู่ที่ระดับเฟอร์มิของสารกึ่งตัวนำ หรือถ้าระดับพลังงานของสถานะผิวที่เสมือนคอนเนอร์อยู่ที่ระดับเฟอร์มิของสารกึ่งตัวนำ ทั้งสองกรณีจะไม่มี การโค้งของแถบพลังงาน

4.1.3 กำแพงศักย์เกิดจากชั้นบาง ๆ ของสารอื่นที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ

ชั้นบาง ๆ ที่ผิวของสารกึ่งตัวนำนี้มักจะเป็นพวกออกไซด์ (oxide) หรือ ไนไตรด์ (nitride) ในทางปฏิบัติชั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดชั้นบาง ๆ นี้ เพราะโดยปกติแล้วผิวของสารกึ่งตัวนำจะสัมผัสกับอากาศ ออกซิเจนหรือนิโตรเจนในอากาศจึงมักทำปฏิกิริยากับสารกึ่งตัวนำเกิดเป็นชั้นบาง ๆ ซึ่งชั้นบาง ๆ นี้อาจทำให้เกิดกำแพงศักย์ได้ เพราะเหตุผลในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2

4.2 วิธีที่ควรทำเมื่อต้องการรอยต่อแบบโอห์มิก

ในหัวข้อ 4.1 ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดกำแพงศักย์ ดังนั้นถ้าต้องการรอยต่อแบบโอห์มิกคือไม่ต้องการกำแพงศักย์ จึงควรใช้วิธีดังนี้

- ก. เลือกโลหะที่มีค่าเวิร์คฟังก์ชันน้อย ๆ สำหรับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น และเลือกโลหะที่มีค่าเวิร์คฟังก์ชันมาก ๆ สำหรับสารกึ่งตัวนำชนิดพี
- ข. เลือกโลหะที่เป็นคอนเนอร (donor) เมื่อเป็นสิ่งเจือปน (impurity) เช่นพวกกรุปห้า สำหรับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นแล้วพยายามทำให้โลหะแพร่ (diffuse) เข้าไปในสารกึ่งตัวนำ เช่นอาจนำไปให้ความร้อน และเลือกโลหะที่เป็นแอกเซพเตอร์ (acceptor) เมื่อเป็นสิ่งเจือปน เช่นพวกกรุปสาม สำหรับสารกึ่งตัวนำชนิดพี แล้วพยายามทำให้โลหะแพร่เข้าไปในสารกึ่งตัวนำ
- ค. ถ้าทำตามข้อ ก. และ ข. แล้วก็ยังไม่ได้รอยต่อแบบโอห์มิก ลองทำให้ผิวของสารกึ่งตัวนำเป็นรอย เช่นลองชุบผิวสารกึ่งตัวนำ วิธีนี้อาจจะทำให้ได้รอยต่อแบบโอห์มิกก็ได้ เพราะการชุบผิวจะทำให้เกิดสถานะผิวชั้น ซึ่งสถานะผิวที่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้ความสูงของกำแพงศักย์ลดน้อยลง จนทำให้รอยต่อกลายเป็นรอยต่อแบบโอห์มิกก็ได้